科学研究費補助金研究成果報告書

平成23年5月12日現在

機関番号:17701 研究種目:基盤研究(C)				
研究期間:平成 20 年度~平成 22 年度				
課題番号: 20560305				
研究課題名(和文)低成長温度(Cu, C)系超伝導薄膜材料の多層構造化による 高性能化・新機能発現				
研究課題名(英文) Development of High Performances and Novel Functions in Low-Growth Temperature (Cu, C) Superconducting Film by Controlling Multi-layer Structure				
研究代表者				
寺田 教男 (TERADA NORIO)				
鹿児島大学・理工学研究科(工学系)・教授)				
研究者番号:20322323				

研究成果の概要(和文):

超伝導を利用したデバイスは、超高速動作、低消費電力といった高いポテンシャルを持 つ、反面、毒性元素の含有、高い形成温度・超伝導異方性などの応用上の問題を持つ高温 超伝導体に対して、本研究では毒性元素を含まず、多層化することで超伝導転移温度が向 上すると期待されている Cu 系高温超伝導体に注目し、その薄膜材料化を目指した。この 系はバルクにおいては高温高圧化でのみ成長する準安定層であるが、まず、炭酸基添加と 格子ミスフィット率が比較的小さい単結晶基板上でのエピタキシャル成長よる構造安定化 により、低成長温度 500 から 600 ℃において、(Cu, C)-1201 構造の薄膜形成に成功した。 この薄膜の表面凹凸が、当初、ユニットセル高さの数倍と、一層の特性向上が見込める多 層化への移行が困難であったことから、続いて、基板と薄膜の中間の格子定数・類似の結 晶構造を持つ SrCuO2 をバッファとして挿入する手法を導入した。その結果、超伝導性と 多層型に必要平坦性を合わせ持つ(Cu, C)-1201 の作製条件の確立に成功した。この上に 1201 層とCaCuO₂無限層を交互堆積した [CaCuO₂/(Cu, C)-1201]×N 構造を行ったところ、 T_{c-onset}: 100K、T_{c(p=0)}: 70K 級の高い超伝導特性を持つ超伝導薄膜の作製に成功した。多層 構造試料の構造解析結果から、CaCuO₂-(Cu, C)-1201界面における歪効果が、この超伝導特性の大幅な向上の起源であることが明らかとなった。以上により、人工積層手法による、 毒性元素を含まず、高臨界温度を有する高温超伝導薄膜材料の創成という本研究課題の目 的を達成したと考える。

研究成果の概要(英文):

Thin film process and enhancement of properties of (Cu, C)-system

 $[(Cu, C)Ba_2Ca_{n-1}Cu_nO_x : (Cu, C)-12(n-1)n]$ high temperature superconductors have been studied. Contrary to the necessity of high temperature and high pressure for fabrication of bulk ceramics of this system, thin films of (Cu, C)-1201 phase have successfully synthesized by utilizing pulsed laser deposition on SrTiO₃ substrate under CO₂ mixed atmosphere. The (Cu, C)-1201 films show technological merits of the low growth temperature of 500 ~ 600 °C and superconducting critical temperature about 50 K which is sufficient to applications of high-speed digital circuits. Though surface roughness of the 1201 films directly on the substrate exceeded c-axis lattice parameter of this phase, it has been improved up to sub-nano meter level by the insertion of $SrCuO_2$ buffer with infinite layer structure between the 1201 film and the substrate. The (Cu, C)-1201/SrCuO₂ structures exhibit similar superconducting properties. These results mean that it is satisfied the necessary conditions for the investigation of the effect of multi-stacking of 1201 and related layers on superconducting properties of it. In the present study, remarkable enhancements of critical temperature are achieved in [CaCuO₂/(Cu, C)-1201]×N (N: repetition number of fundamental structure) multi-layered structure. $T_{c-onset}$ and $T_{c(p=0)}$ reach ~ 100 K and > 70 K, respectively. It is also noteworthy that the growth temperature of such high- T_c specimens still stays around 500 °C. Structural analysis of the high- T_c specimens has revealed the strain at their hetero-interfaces is the main origin of the enhancement of superconductivity.

The achievements mentioned above shows that the novel superconducting film with

technological merits: high T_c and low growth temperature, without toxic element has developed by adopting the hetero-interface effect to (Cu, C)-1201 layer, which also means the objective of this research is successfully achieved.

交付決定額

(金額単位:円)

	直接経費	間接経費	合 計
2006年度			
2007年度			
2008年度	2,000,000	600,000	2,600,000
2009年度	800,000	240,000	1,040,000
2010年度	800,000	240,000	1,040,000
総計	3,600,000	1,080,000	4,680,000

研究分野:工学

科研費の分科・細目:電気電子工学・ 電気・電子材料)半導体、誘電体、磁性体、超誘電体、 有機物、絶縁体、超伝導体など)

キーワード:超伝導材料・素子、量子エレクトロニクス、強相関エレクトロニクス、 表面・界面物性

1. 研究開始当初の背景

超伝導デバイスはマイクロ波領域での超 高選択比フィルタ、100GHz 級のクロック周 波数での超高速動作素子、量子計算用素子な ど、その高度且つ独自のポテンシャルから次 世代エレクトロニクスにおける基幹的要素 の一つと見なされている。低温超伝導回路は 上記の高速動作が検証されつつあるが応用 には半導体回路との連携が必要であり、両者 間の温度・電圧レベルのギャップを埋める回 路の導入が望ましいとされている。超伝導臨 界温度・エネルギーギャップ等の基礎物性に 優れる高温超伝導回路を利用できれば、動作 温度、動作周波数の上限の大幅な向上等によ り、応用の高度化、経済的制約の大幅な緩和 が期待される。申請者らは高温超伝導層/低 温超伝導層界面の電子状態制御による両超 伝導層間の高強度超伝導接続、集積化に適す る積層型高温超伝導ジョセフソン接合の再 現性の良い作成手法を、独自に開発した超伝 導膜の高度な作製技術、その積層構造におけ る微視的構造・電子状態の評価・制御手法を 活用することにより実現してきた。

しかしながら、現在、高温超伝導応用は限 定された分野にとどまっている。その主因は、 薄膜形成温度が700~900 ℃と高いこと、コ ヒーレンス長が異方的且つ極めて短く、極限 的微細加工が必要なこと、高温で応用可能な 材料は Hg,Tl 等の毒性元素を含んでいること にある。実際、集積回路に適するとされる c-軸配向 YBa₂Cu₃O₇ (YBCO)超伝導層でも 700℃を越える成長温度が必要であり、c-軸 配向 YBCO と界面改質バリアを用いた積層 型ジョセフソン接合で申請者らが行った実 験でも、単原子レベルのバリア層厚分散が必 須であり、また、高い成長温度により超伝導 電極間ショートや特性分散が顕著となるこ とが分かっている。これらは本格的回路応用 の限定要因となっており、低温成長が可能・ 高臨界温度のエレクトロニクス用超伝導薄 膜材料の開発及び極限的加工無しでデバイ ス機能の発現が可能な電子状態を有する材 料の開発が切望されてきた。

申請者らは、高強度酸素ビーム等を用いた 高温超伝導体の電荷供給ブロックの荷電状 態の制御技術を開発し、これにより多層構造 TI-1223 系において 133 K を越える最高レベ ルの臨界温度を実現して、この制御が超伝導 特性向上のための有効な手法であることを 実証するとともに、その発展として、電荷供 給層にCuイオンを含む無限層構造 MCuO₂の 多層構造(Cu,M)Ba₂Ca_{n-1}Cu_nO_x

[(Cu,M)-12(n-1)n]等が高い臨界温度を有する とともに、電子構造の変調範囲が広く、n>3 の相では弱結合無しでも自発生成される非 整数量子磁束(バンド間位相差ソリトン)を 用いることで接合形成無しに量子磁束デバ イスが実現される可能性があることを指摘 してきた。

これらの知見に基づく初動研究の結果、正 方晶構造、毒性元素を含まない(Cu, C)Ba₂CuO_{2±d} [(Cu, C)-1201]系パルスレーザー 堆積薄膜が、同一装置でのYBCO 膜の形成温 度〜700 °C と比較して顕著に低い550 °C 程 度の低温成長(放射温度計及び熱電対による 多重計測) as-grown 膜で50K 以上の超伝導性 が得られること²⁾、電荷供給層が単層で低異 方性化に適するとともに電子構造変調幅が 極めて大きいこと見出した(図1)。続いて、 本提案に先行して科学研究費補助金により 実施した研究において(Cu, C)-1201 超伝導薄 膜の成長温度下限の極限追求を行い、60 K級 の臨界温度が成長温度 480~500°C で得られ ること、10 K程度の臨界温度低下を許容でき る場合には成長温度を 450 °C まで低減可能 なことを実験的に見出すとともに、第1原理 計算により、この系を多層構造化した (Cu,C)-1223,1234がCu-O単層の電荷供給層の 酸化度制御により非等価な CuO₂ 面が異なる 超伝導状態に凝縮する多成分超伝導の実現 に適した電子構造を持つことを見出してい た。

多層構造への発展性を有する正方対称性 を持つ(Cu.C)-Ba-O 単独膜における 50~60 K 級の超伝導発現とその低温成長は当グルー プが世界に先駆けて得た成果であり、高温超 伝導の応用への障害を解消するブレークス ルーとなるものである。(Cu,C)-1201 膜の臨界 温度はデジタル応用における最低条件を満 足しているが、申請者による人工格子に関す る予備実験では Ba-Cu-O 層と SrCuO₂無限層 構造を交互積層した 1212 相に対応する人工 格子構造で超伝導開始温度が 10 K 程度上昇 することが観測され、経験則及び(Cu.C)系バ ルク研究からも、1201 相を多層化した (Cu,C)-12(n-1)n 相では 80~120 K への臨界温 度の飛躍的上昇、異方性低減、ソリトン発生 に適した電子構造の実現が見込まれること を明らかにしていた。

2. 研究の目的

本研究は前述の成果を踏まえて、低成長温 度・無毒性(Cu,C)系超伝導薄膜を人工格子法 により多層化することにより、高臨界温度 化・超伝導波動関数の最適化を図り、次世代 超伝導量子エレクトロニクスのための高臨 界温度・低成長温度薄膜材料を創成するため の有望な出発点を確立することを目的とし た。

3. 研究の方法

まず、複数種の層の精密積層が行えるパル スレーザー堆積装置に高強度原子状酸素ビ ーム源を併用する独自の手法により、 Ba-Cu-O層とAECuO₂ (AE:アルカリ土類)からなる超格子構造を(Cu,C)-1201 超伝導薄膜 で最適化した条件近傍で形成し、Ba-Cu-Oブ ロックが優先的にホールドープされ、これが 主要な超伝導ブロックとなる(Cu,C)-12(n-1)n 薄膜を作成して、CuO₂層数nと臨界温度の関 係を明らかにする。また各層数毎に、TI-1223 で実現した臨界温度133 Kの起源となった単 位胞内ホール分布の制御を行い、高臨界温度 化を図る。併せて、低異方性もたらす電荷供 給層の高濃度ドープを実施し、異方性の下限 を明らかにする。このとき、膜形成装置と低 温・角度分解光電子分光装置(LT-ARPES)、走 査プローブ顕微鏡を単一の超高真空に統合 した独自の高度システムを用い、本質的電子 構造を明らかにする。

これらにより高温領域動作超伝導デバイ ス次世代量子エレクトロニクスに向けた高 臨界温度・易合成な薄膜材料の材料科学的基 盤・作成プロセスを確立することを目指した。

4. 研究成果

まず、(Cu, C)1201 を基幹とする積層構 造・人工格子におけるヘテロ界面精密制御 による超伝導特性の極限追求、構成元素同 時供給による形成技術を開発した。 (Cu, C)1201 を基幹とする積層構造・人工格 子におけるヘテロ界面精密制御による超伝 導特性の極限追求、構成元素同時供給によ る形成技術の開発を中心に研究を進めた。

SrTiO₃ (100)面に直接堆積した c-軸配向 (Cu, C)-1201 薄膜はアンダードープ状態に あるとともに、過大な格子ミスマッチによ



図1 SrTiO₃ 基板に直接、低温成長した(Cu, C)-1201 薄膜の抵抗-温度特性; 非晶質 CaCuO₂ で保護。





図 2 Buffered (Cu, C)-1201 表面トポグラフィ 一像 (a)、そのラインプロファイル(b).

り基板から数 nm で積層欠陥が発生し Tcは 50 K 級にとどまる (図1)。一方、SrTiO₃ と(Cu, C)-1201 相の中間の面内格子定数を 持つ無限層構造 SrCuO2 をバッファ層とし て挿入した場合、1201 相は厚さ 100 nm 程 度まで積層欠陥が発生せず歪格子として原 子層オーダーの超平坦性を持ってエピタキ シャル成長することが 1201 層面内格子定 数の層厚依存性等から見出された(図2(a)、 (b))。SrCuO₂層自体も歪格子モードで成長 するため、(Cu, C)-1201/SrCuO₂界面のミス フィット率はSrCuO2層厚により変化する。 この実験結果を活用して、(CuC)-1201層に 対する界面歪効果を検討した。その結果、 図3に示すように SrCuO2 層厚を薄くする ことでミスフィット率を増大させた場合、 抵抗率-温度特性における超伝導転移が多 段となるとともに、T_{c-onset} > 70 K の成分が 混在し始めることが見出された。これは界 面歪あるいは歪環境下での成長により



図3 無限層構造 SrCuO₂バッファ層/SrTiO₃上に 成長した(Cu, C)-1201 層の電気抵抗-温度特 性と SrCuO₂層厚の関係;界面歪による *T_{c-onset}*の上昇。

1201 層内 CuO2 面のキャリア濃度上昇また は平坦化が促進されることを示している。 以上の結果と超高圧でのみ合成が可能な 多層型(Cu, C)系において Ba-Cu-O ブロック 間の構造が、CaCuO2無限層構造をとること した を 考 して作成 慮 [(Cu,C)-1201/CaCuO₂]N 積層構造(N: 積層 繰返し回数)において、図4に示す顕著な 超伝導臨界温度の向上を初めて見出した。 SrTiO₃上に直接成長した 1201 相単層膜と 比較して約30KのT_c上昇が見られ、最高 値は液体窒素温度と同等となっている。こ れらは界面歪、歪エピタキシャル成長がこ の系の超伝導特性の支配要因であることを 示すとともに、N の増大による特性劣化が 見られることは高 T。領域が基板近傍の界 面にする可能性を示唆している。提案時点 では界面歪効果の定量的評価・最適化はな されておらず、一部の試料では80K以上の 温度で磁気シールディング信号が観測され ていることを考慮すると図3の特性は、こ の系の超伝導特性の極限に未だ達していな いと判断され、1201 層厚変化、挿入層物質 による格子ミスフィットの制御による界面 効果の最適化、ヘテロエピタキシャル成長 のリアルタイム観測に基づく成長方向の歪 分布制御による高 T_c発現領域の広域化が 期待できる。また、(Cu, C)-Ba-Ca-O 系薄膜 作成において、上記の積層法と全構成元素 を同時供給する手法間の主要な際は成長表 面/気相の反応にあることが予備実験から 分かっており、最適組成決定後には高 Tc 薄膜を単一ターゲットを用いた PLD・スパ ッタなどの実用的手法で作成する技術の確 立が期待できる。

N=2N=4 N=8 N=2CaCuO. N=1 (Cu, C)-1201 CaCuO. 繰り返し a~3.89 Å a~3.93Å a~3.92 Å (Cu, C)-1201 SrCuO. N≤8;エピタキシャル成長の維持を確認 SrTiO. 1.5 1.2 N=8 1.0 [mQ.cm] Resistivity [mΩ·cm] 50 N=8 0.8 N=4 tivity N=4 0.6 N=2 щ N=2 0.2 N=I 0.0 0:0 70 75 80 85 Temperature(K) 50 100 150 Temperature(K) 0 200 250 60 65 90 95 100

本研究では毒性元素を含まず、多層化す

図4 [(Cu, C)-1201/CaCuO₂]_N積層構造(成長温度 ~ 500 ℃)の電気抵抗率-温度特性、RHEED像、 面内格子定数の積層繰返し回数 N 依存性;**積層化による超伝導特性の顕著な向上**。

ることで超伝導転移温度が向上すると期待 されるなど材料科学・応用の両面で注目す べき特徴を持つ Cu 系高温超伝導体に注目 し、まず、バルクにおいては高温高圧化で のみ成長する(Cu, C)-1201 構造の準安定相 を、基板によるエピタキシャル効果と炭酸 基添加よる構造安定化により低成長温度 500 から 600 ℃において薄膜形成に成功し た。続いて、基板と薄膜の中間の格子定数・ 類似の結晶構造を持つ SrCuO₂ をバッファ として挿入する手法を導入した。その結果、 超伝導性と多層型に必要な表面凹凸が単位 胞高さを十分に下回る、優れた平坦性を持 つ(Cu, C)-1201 の作製条件の確立に成功し た。この上に 1201 層と CaCuO₂ 無限層を交 互堆積した [CaCuO₂/(Cu, C)-1201]×N 構 造を行ったところ、 $T_{c-onset}$: 100K、 $T_{c(\rho=0)}$: 70 K 級の高い超伝導特性を持つ超伝導薄 膜の作製に成功した。この膜の構造を解析 結果から、この超伝導特性の大幅な向上は CaCuO₂-(Cu, C)-1201 界面における歪効果 を検討したところ、SuCuO2 膜厚に依存する 系統的特性変化が見られ、面内歪効果によ って、超伝導特性が影響を受けることを確 認した。以上、人工積層手法による、毒性 元素を含まず、高臨界温度を有する高温超 伝導薄膜材料の創成という本研究課題の目 的を達成したと考える。

5. 主な発表論文等 (研究代表者、研究分担者及び連携研究者に は下線)

〔雑誌論文〕(計19件)

- T. Fukae, H. Ichiki, H. Kashiwabara, T. Shiota, A. Yamanda, S. Ishizuka, K. Matsubara, S. Niki, Y. Yoshimura and <u>N. Terada</u>, "Characterization of Electronic Structure of Grain Boundaries in CIGS Absorber Layers by Kelvin Probe Force Microscopy", Proc. 26th European Photovoltaic Sci. Engng. Conf., pp.3349-3352 (2010). 査読有
- ② T. Yamamoto, K. Tanaka, A. Yamanaka, <u>T. Okuda</u>, K. Tokiwa, A. Iyo, Y. Tanaka, A. Sundaresan and <u>N. Terada</u>, "Synthesis of Smooth and Superconducting (Cu,C)-Ba-O / CaCuO₂ / (Cu,C)-Ba-O Films using SrCuO₂ Buffer", Physica C vol.470, pp.S71-S72 (2010). 査読有
- ③ K. Kikunaga, T. Yamamoto, Y. Tanaka, N. Kikuchi, T. Tokiwa, T. Watanabe and <u>N. Terada</u>, "In-situ characterization of transport properties of (Cu, C)sysytem thin films", Physica C vol.470, pp.678-681 (2010). 査読 有

- ④ Y. Tanaka, A. Crisan, D.D. Shivagan, A. Iyo, P.M. Shirage, K. Tokiwa, T. Watanabe and <u>N.</u> <u>Terada</u>, "Phase diagram of a lattice of pancake vortex molecules", Physica C vol.**469**, pp.1129-1131 (2009). 査読有
- ⑤ Y. Kondo, I. Yano, I. Shigeta, M. Ito, M. Hiroi, H. Manaka and <u>N. Terada</u>, "Magnetic Properties of the Heusler Alloys (Fe_{1-x}Co_x)₂MnSi", J. Phys.:Conf. Series vol.**150**, pp.42099-1~4 (2009). 査読有
- ⑥ <u>T. Okuda</u>, Y. Beppu, Y. Fujii, T. Kishimoto, K. Uto, T. Onoe, N. Jufuku, S. Hidaka, <u>N. Terada</u> and S. Miyasaka, "Hole-doping effect on the magnetic state of delafossite oxide CuCrO₂", J. Phys.:Conf. Series vol.**150**, pp.42157-1~4 (2009). 査読有
- ⑦ H. Manaka, S. Nagata, Y. Watanabe, K. Kikunaga, T. Yamamoto, <u>N. Terada</u> and <u>K. Obara</u>, "Percolated-Induced Ferrimagnetism", J. Phys.:Conf. Series vol.145, pp.12080-1~4 (2009). 査読有
- ⑧ Y. Tanaka, A. Crisan, D.D. Shivagan, A. Iyo, P.M. Shirage, K. Tokiwa, T. Watanabe and <u>N.</u> <u>Terada</u>, "Phase diagram of a lattice of pancake vortex molecules", Physica C, vol.**469** pp.1129-1131, (2009). 査読有
- (9)K. Kikunaga, T. Yamamoto, M. Mitsunaga, Y. Mahara, Y. Tanaka, N. Kikuchi, K. Tokiwa, T. Watanabe, and N. Terada, "In-situ characterization of transport properties of superconducting (Cu, C)-1201 films, Journal of Physics Conf. Series vol.150 pp.052108-1~4 (2009). 査読有
- III. Manaka, Y. Hirai, Y. Hachigo, M. Mitsunaga, M. Ito and <u>N. Terada</u>, "Spin-Liquid State Study of Equilateral Triangle S=3/2 Spin Tubes Formed in CsCrF₄", Journal of the Physical Society of Japan vol. **78**, pp.093701-1~4 (2009). 査読 有
- M. Hiroi, T. Rokkaku, K. Matsuda, T. Hisamatsu, I. Shigeta, M. Ito, T. Sakon, K. Koyama, K. Watanabe, S. Nakamura, T. Nojima, T. Nakano, L. Chen, T. Fujiwara, Y. Uwatoko, H. Manaka and <u>N. Terada</u>, "Ferromagnetism and spin-glass transitions in the Heusler compounds Ru_{2-x}Fe_xCrSi", Phys. Rev. B vol. **79**, pp.224423-1~10 (2009). 査読有
- T. Yamamoto, K. Kikunaga, M. Mitsunaga, <u>T. Okuda, K. Obara</u>, N. Kikuchi, Y. Tanaka, K. Tokiwa, T. Watanabe and <u>N. Terada</u>, "Synthesis of suoerconducting (Cu, C)-Ba-O films on SuCuO₂ buffer by pulsed laser deposition", J. Phys. Conf. Series vol.150, pp.52286-1~4 (2009). 査読有
- 13 S. Niki, S. Ishizuka, K. Matsubara, K. Tampo,

H. Komaki, Y. Kamikawa, K. Maejima, T. Yoshiyama, K. Mizukoshi, A. Yamada, H. Nakanishi and <u>N. Terada</u>, "Progress in CIGS solar cell technologies", IEEE Laser Electro-Opt. Soc., pp.95-96 (2008). 査読有

- D.D. Shivagana, P.M. Shiragea, A. Crisanb, Y. Tanaka, A. Iyo, K. Tokiwa, T. Watanabe and <u>N. Terada</u>, "AC-Susceptibility study on vortex-molecule lattice in supermultilayer cuprate", Physica C vol.468, pp.1281-1286 (2008). 査読有
- IB H. Manaka, Y. Watanabe, K. Kikunaga, T. Yamamoto, <u>N. Terada</u> and <u>K. Obara</u>, "Conversion from transparent antiferromagnet KNiF₃ to transparent ferrimagnets", Appl. Phys. Lett. vol.**92**, pp.04250-(1)~(3) (2008). 査読有
- 16 D. D. Shivagan, P. M. Shirage, A. Crisan, Y. Tanaka, A. Iyo, Y. Kodama, K. Tokiwa, T. Watanabe, <u>N. Terada</u> and N. Hamada, "Vortex melting line and anisotropy of a multilayered superconductor", Supercond.Sci. Technol. vol.**21**, pp.95002-1~7 (2008). 査読有
- ① <u>T. Okuda</u>, Y. Beppu, Y. Fujii, T. Onoe, <u>N.</u> <u>Terada</u> and S. Miyasaka, "Specific Heat of Delafossite Oxide CuCr_{1-x}Mg_xO₂ for 0≤x≤ 0.03", Phy. Rev. B 77, pp.134423-1~5 (2008). 査読有
- 18 D. D. Shivagan, P. M. Shirage, A. Crisan, Y. Tanaka, A. Iyo, Y. Kodama, K. Tokiwa, T. Watanabe, <u>N. Terada</u> and N. Hamada, "Vortex melting line and dimensional crossover", Physica C vol.468, pp.749-752 (2008). 査読 有
- T. Yamamoto, K. Kikunaga, K. Takeshita, <u>K.</u> <u>Obara, T. Okuda</u>, N. Kikuchi, Y. Tanaka, K. Tokiwa, T. Watanabe and <u>N. Terada</u>, "Pulsed laser deposition synthesis of superconducting (Cu, C)-Ba-O thin film", Vacuum **83**, pp.531-533 (2008). 査読有

〔学会発表〕(計3件)

- 25th European Photovoltaic Sci. Engng. Conf., (2010 Valencia, Spain), T. Fukae, H. Ichiki, H. Kashiwabara, T. Shiota, A. Yamanda, S. Ishizuka, K. Matsubara, S. Niki, Y. Yoshimura and <u>N. Terada,</u> "Characterization of Electronic Structure of Grain Boundaries in CIGS Absorber Layers by Kelvin Probe Force Microscopy". (2010.9.7)
- 第57回応用物理学関係連合講演会シン ポジウム,(平塚市,2010年),<u>寺田教男</u>, 柏原博豪,石塚省吾,桜井啓一郎,松原浩 司,山田昭政,中田時夫,「電子分光法に よるバッファ層およびバッファ/CIGS層 界面の電子構造評価」 [招待講演].

(2010.3.17)

③ 2008 Spring Meeting of European Materials Research Society (Strasbourg, France), <u>N.</u> <u>Terada</u>, H. Kashiwabara, S. Teshima, K Funai, <u>T. Okuda</u>, S. Ishizuka, K. Sakurai, A. Yamada, K. Matsubara and S. Niki, "Ga Substitution Ratio Dependence of Electronic Structure at Interfaces between CBD-CdS and CIGS Grown by H₂O-Introduced co-Evaporation" [invited]. (2008.5.30)

〔図書〕(計3件)

- <u>寺田教男</u>,「太陽電池の基礎と応用」(日本学術振興会第175委員会監修,小長井誠,山口真史,近藤道雄編著), pp.166-168,(培風館)(2010).
- <u>寺田 教男</u>,「CIGS 薄膜太陽電池の最新技術(中田 時夫 監修)」, pp.227-240, (シ ーエムシー出版) (2010).
- ③ <u>寺田 教男</u>,「太陽電池 革新的技術全集
 2009 年版」, pp.303-316, (技術情報協会) (2009).

〔産業財産権〕

○取得状況(計1件)

①名称: "Method of Genaration and Method of Detection of Interband Phase Difference Soliton and Interband Phase Difference Circuit"

発明者: Y. Tanaka, A Iyo, A. Crisan, K. Tokiwa, T. Watanabe and <u>N. Terada</u>

権利者: AIST, Kagoshima Univ. and Science Unv. Tokyo

種類: USA Patent

- 番号: Application number 11/845420,
- 取得年月日:2009年1月許可通知受理 国内外の別:国外

[その他]

受賞: "Award : JPSJ Papers of Editors' Choice", H. Manka, Y. Hirai, Y. Hachigo, M. Mitsunaga M. Ito and <u>N. Terada</u>, "Spin-Liquid State Study of Equilateral Triangle S=3/2 Spin Tubes Formed in CsCrF₄", (2009).

6.研究組織
(1)研究代表者
寺田 教男 (TERADA Norio)
鹿児島大学・大学院理工学研究科・教授
研究者番号:20322323
(2)研究分担者
奥田 哲治 (OKUDA Testuji)
鹿児島大学・大学院理工学研究科・准教授
研究者番号:20347082
小原幸三 (OBARA Kozo)
鹿児島大学・大学院理工学研究科・教授
研究者番号:10094129